This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

**EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

08250454

PUBLICATION DATE

27-09-96

APPLICATION DATE

10-03-95

APPLICATION NUMBER

07051458

APPLICANT:

NIPPONDENSO CO LTD;

INVENTOR : YAMAMOTO MASAHIRO;

INT.CL.

H01L 21/301 // H01L 21/768 H01L

29/84

TITLE

MANUFACTURE OF

SEMICONDUCTOR DEVICE AND

DICING JIG USED FOR THE DEVICE

可助却または安永部付きウェハ

ABSTRACT :

PURPOSE: To divide a semiconductor wafer into chips at a high yield by dicing the semiconductor wafer with a dicing jig having through holes for vacuum chucking in recessed sections or recessed section forming areas or on the outside of the forming areas in an area facing the mobile section or protecting section of semiconductor devices.

CONSTITUTION: A discoid semiconductor wafer 1 on which a plurality of semiconductor devices respectively having movable sections or projecting sections are formed in each chip is diced into the semiconductor devices with a dicing jig 2 having a movable section, project protective recessed sections 2a, through holes 2b which become wafer fixing vacuum chucking holes, an O-ring 2c for supporting the wafer 1, an air introducing port 2d, and an air blowing port 2e in accordance with a prescribed process flow. A dicing jig made of a high- rigidity material (metal, ceramic, etc.) is used as the jig 2, but it is suitable to use a ceramic material 'Macol' which can be worked easily is suitable. It is also possible to use a silicon wafer for the jig 2.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO

特開平8-250454

(43)公開日 平成8年(1996)9月27日

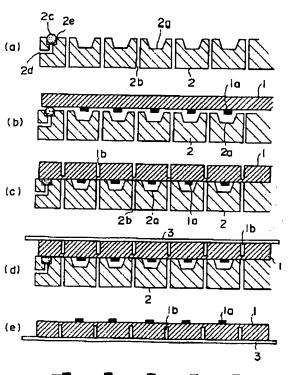
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号 广内整理番号	FI	技術表示箇所
H 0 1 L 21/301		H 0 1 L 21/78	M
# H O 1 L 21/768		29/84	· Z
29/84		21/78	Q
		21/90	Z
		審查請求 未請求 請	求項の数7 OL (全 7 貞)
(21)山願番号	特願平7-51458	(71)山願人 000004260	
(oo) thee		口木電装株	
(22)出顧日	平成7年(1995)3月10日	1	市昭和町1丁日1番地
		(72)発明者 占原 晋二	
			市昭和町1丁目1番地 日本電
		装株式会社	
•		(72)発明者 小原 文雄	
			市昭和町1丁目1番地 日本電
	•	装株式会社	
		(72)発明者 山木 正博	
		愛知県刈谷	市昭和町1丁目1番地 日本電
		装株式会社	内
		(74)代理人 弁理士 鈴	江 武彦

(54) 【発明の名称】 半導体装置の製造方法及びそれに用いるダイシング治具

(57)【要約】

【目的】 本発明は、半導体ウェハの表面に可動部や突起物を有する機能素子を備える半導体装置を効率的にダイシングカットするようにした半導体装置の製造方法及びそれに用いるダイシング治具を提供する。

【構成】 本発明によると、前記可動部または突起部と対向する領域に凹部及び該凹部の形成領域内または領域外に真空チャック用の貫通孔が形成されたダイシングカットすることを特徴とする半導体装置の製造方法が提供される。また、本発明によると、前記半導体ウェハの可動部または突起部と対向する部分に形成されるもので、前記可動部または前記突起部を保護する凹部と、該凹部の形成領域内または領域外に形成されるもので、ダイシング装置の真空チャックステージからのパキューム吸引により前記半導体ウェハを固定する貫通孔とを有するダイシング治具が提供される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体基板の表面に可動部または突起部を有する機能素子を備える半導体装置の製造方法において、

前記可動部または突起部と対向する領域に凹部及び該凹部の形成領域内または領域外に真空チャック用の貫通孔が形成されたダイシング治具を用いて半導体ウェハをダイシングカットすることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項2】 前記ダイシング治具として剛性の高い金 10 属、セラミックスなどの材料からなる治具あるいは面方位(110)のシリコンウェハや、(100)と(110)とを絶縁体などを介して接合したシリコンウェハを用いる請求項1記載の半導体装置の製造方法。

【請求項3】 半導体基板の表面に可動部または突起部を有する機能素子が形成された半導体ウェハを前記ダイシング治具に搭載する工程と、

ダイシングカット装置のステージからの真空引きにより 前記ダイシング治具内に形成された貫通孔を介して前記 半導体ウェハを吸引し、前記半導体ウェハと前記ダイシ ング治具とを固定する工程と、

前記ダイシングカット装置により、前記半導体ウェハ裏 面から表面方向に前記半導体ウェハの厚み半分以上切り 込む工程と、

前記半導体ウェハ裏面に粘着シートを貼り付ける工程 と、

前記粘着シートを貼り付ける工程の後、前記半導体ウェハの切り込みが広がる方向に前記粘着シートに引張力を与えるか、または、熱あるいは振動による衝撃を与えてチップ状に分割する工程とを含む請求項1記載の半導体装置の製造方法。

【請求項4】 前記凹部の直下に前記貫通孔を形成した前記ダイシング治具の表面に第1の粘着シートを貼り付ける工程と、

ダイシングカット装置のステージからの真空引きにより 前記ダイシング治具内に形成された貫通孔を介して前記 第1の粘着シートを前記凹部に沿って吸引する工程と、

前記第1の粘着シート上に、表面に可動部または突起部 を有する半導体ウェハを貼り付ける工程と、

前記貼り付ける工程の後、前記半導体ウェハを裏面より 40 表面方向ヘフルカットでチップ毎にダイシングカットする工程と、

前記ダイシング工程の後、前記半導体ウェハ裏面に第2 の粘着シートを貼り付ける工程と、

前記第2の粘着シートの貼り付け後、前記第1の粘着シートの粘着力を低下させてから、前記第1の粘着シートから前記半導体ウェハを剥し、前記半導体ウェハが貼り付けられた前記第2の粘着シートに引張力を与えて前記

【請求項5】 半導体基板の表面に可動部または突起部を有する機能素子を備える半導体装置の製造方法において、

前記半導体装置可動部または突起部の周辺を取り囲むように接着剤などの印刷できる材料で半導体ウェハ表面に 壁を形成する工程と、

前記半導体ウェハ表面に形成された壁上に粘着シートを 貼る工程と、

前記粘着シートを貼る工程の後、前記半導体ウェハの裏 面より表面方向に前記半導体ウェハの厚みの半分以上切り込む工程と、

前記粘着シートを前記半導体ウェハの切り込みが広がる 方向に引張力または、熱や振動による衝撃を与えてチップ状に分割する工程とを含む半導体装置の製造方法。

【請求項6】 半導体ウェハの表面に形成される機能案子の可動部または突起部と対向する部分に形成されるもので、前記可動部または前記突起部を保護する凹部と、該凹部の形成領域内または領域外に形成されるもので、ダイシング装置の真空チャックステージからのパキューム吸引により前記半導体ウェハを固定する質通孔とを有することを特徴とするダイシング治具。

【請求項7】 前記治具の周縁部にパッキングを挿入す

前記溝の底面から上方にガスを吹き出す構造を有することを特徴とする請求項6記載のダイシング治具。

【発明の詳細な説明】

[0001]

30

【産業上の利用分野】本発明は半導体装置の製造方法に関し、特にトランジスタ型加速度センサや圧力センサなどの可動部をチップ内に有する半導体装置やエアープリッジ配線構造などのように機械的な強度に問題がある突起物を持つ半導体装置を効率的にダイシングカットするようにした半導体装置の製造方法及びそれに用いるダイシング治具の構造に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、シリコンウェハ上に形成された半 導体集積回路素子をチップ分割する方法として、通常は 粘着シート上に置かれたシリコンウェハをダイシングカ ット装置を用いてダイシングカットを行うことによって なされていた。

【0003】この際、シリコンの切りくずを除去したり、切断時の熱を放熱するため、また、カットが容易にできるように大量の切削水を流しながらウェハをカットしてチップ状に分割していた。

【0004】しかしながら、チップ内に例えば、トランジスタ型加速度センサのように可動部を有する素子やエアーブリッジ配線構造のように機械的強度が弱い突起物を有する機能素子が存在する場合、この大量の切削水の エカム半面温力に上り機能素子が破壊されたり、正常な 10

【0005】この問題に対し、従来技術として、エアーブリッジ構造に関しては、特開平2-106947号公報ではウェハ上にレジストを塗布して硬化した状態でダイシングカットし、その後、オゾン雰囲気中の紫外線照射してレジストを除去する方法が提案されている。

【0006】しかるに、この方法では紫外線の当たらない領域にはレジストが残ったり、また、可動部を有する素子においてはレジスト塗布時にレジストの粘性やスピンナーの回転(角速度)により可動部が破損されたり、正常動作ができなくなると共に、そのレジストを除去する好ましい方法が存在しないなどの問題がある。

【0007】このようにして、従来の技術では可動部や 突起物を有する半導体装置を高歩留りでチップ分割をす ることができないのが実状であった。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明は以上のような点に鑑みてなされたもので、半導体装置内の機能素子が有するトランジスタ型加速度センサの可動ゲートや圧力センサのダイアフラムのような可動部またはエアーブリッジ配線構造のような突起物を、ダイシングカット時にレジストなどの液体を使用することなく保護してダイシングカットすることにより、高歩留りでチップ分割をすることができるようにした半導体装置の製造方法及びそれに用いるダイシング治具を提供することを目的としている。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明によると、上記課題を解決するために、半導体基板の表面に可動部または突起部を有する機能素子を備える半導体装置の製造方法において、前記可動部または突起部と対向する領域に凹 30 部及び該凹部の形成領域内または領域外に真空チャック用の貫通孔が形成されたダイシング治具を用いて半導体ウェハをダイシングカットすることを特徴とする半導体装置の製造方法が提供される。

【0010】また、本発明によると、前記ダイシング治 具として剛性の高い金属、セラミックスなどの材料から なる治具あるいは而方位(110)のシリコンウェハ や、(100)と(110)とを絶縁体などを介して接 合したシリコンウェハを用いる半導体装置の製造方法が 提供される。

【0011】また、本発明によると、半導体基板の表面に可動部または突起部を有する機能素子が形成された半導体ウェハを前記ダイシング治具に搭載する工程と、ダイシングカット装置のステージからの真空引きにより前記ダイシング治具内に形成された貫通孔を介して前記半導体ウェハを吸引し、前記半導体ウェハと前記ダイシングカット装置により、前記半導体ウェハ裏面から表面方向に前記半導体ウェハの厚み半分以上切り込む工程と、前記半導体ウェハ裏面に粘着シートを貼り付ける工程と、前記粘着シ 50

ートを貼り付ける工程の後、前記半導体ウェハの切り込みが広がる方向に前記粘着シートに引張力を与えるか、または、熱あるいは振動による衝撃を与えてチップ状に分割する工程とを含む半導体装置の製造方法が提供される。

【0012】また、本発明によると、前記凹部の直下に 前記貫通孔を形成した前記ダイシング治具の表面に第1 の粘着シートを貼り付ける工程と、ダイシングカット装 慣のステージからの真空引きにより前記ダイシング治具 内に形成された貫通孔を介して前記第1の粘着シートを 前記凹部に沿って吸引する工程と、前記第1の粘着シー ト上に、表面に可動部または突起部を有する半導体ウェ ハを貼り付ける工程と、前記貼り付ける工程の後、前記 半導体ウェハを裏面より表面方向へフルカットでチップ 毎にダイシングカットする工程と、前記ダイシング工程 の後、前記半導体ウェハ裏面に第2の粘着シートを貼り 付ける工程と、前記第2の粘着シートの貼り付け後、前 記第1の粘着シートの粘着力を低下させてから、前記第 1の粘着シートから前記半導体ウェハを剥し、前記半導 体ウェハが貼り付けられた前記第2の粘着シートに引張 力を与えて前記チップ毎の間隔を広げる工程とを含む半 導体装置の製造方法が提供される。

【0013】また、本発明によると、半導体基板の表面に可動部または突起部を有する機能素子を備える半導体装置の製造方法において、前記半導体装置可動部または突起部の周辺を取り囲むように接着剤などの印刷できる材料で半導体ウェハ表面に壁を形成する工程と、前記半導体ウェハ表面に形成された壁上に粘着シートを貼る工程と、前記粘着シートを貼る工程の後、前記半導体ウェハの裏面より表面方向に前記半導体ウェハの厚みの半分以上切り込む工程と、前記粘着シートを前記半導体ウェハの切り込みが広がる方向に引張力または、熱や振動による衝撃を与えてチップ状に分割する工程とを含む半導体装置の製造方法が提供される。

【0014】また、本発明によると、半導体ウェハの表面に形成される機能素子の可動部または突起部と対向する部分に形成されるもので、前記可動部または前記突起部を保護する凹部と、該凹部の形成領域内または領域外に形成されるもので、ダイシング装置の真空チャックステージからのパキューム吸引により前記半導体ウェハを固定する貫通孔とを有することを特徴とするダイシング治具が提供される。

【0015】さらに、本発明によると、前配治具の周縁部にパッキングを挿入する溝と、前配溝の底面から上方にガスを吹き出す構造を有することを特徴とするダイシング治具が提供される。

[0016]

40

【作用】本発明の半導体装置の製造方法の一態様によれば、ダイシングカット時、ウェハはダイシング治具内のウェハ固定用真空チャック貫通孔を介して、ダイシング

5

カット装置の真空チャックステージからのバキューム吸引により固定される。

【0017】その際、半導体装置の可動部や突起物はダイシング治具の凹部により保護される。

【0018】 上記の構成により、レジストなどの液体を可動部などの固定に用いる必要がないために、レジストなどの液体の統布や除去工程をなくすことができ、可動部や突起物のある半導体装置のダイシングカットを効率的に行うことが可能となる。

【0019】従って、本発明によれば、「動船または突 10 起部を有する半導体装置が形成されたウェハを高歩留り でチップ分割することができる。

[0020]

【実施例】以下図面を参照して本発明の実施例につき説 明する。

【0021】(第1の実施例)この第1の実施例では、図1に示すように、各チップ内に可動部や突起物を有する半導体装置が複数個形成されている円盤状のウェハ1に対応する可動部または突起物保護用凹部2a、ウェハ固定用真空チャック穴となる質通孔2b、ウェハ支持用のOリング2c及びエアー導入口2dとエアー吹出し口2eとを有するダイシング治具2を用いて、図2に示すような工程フローによりダイシングカットを実行する。

【0022】なお、本発明で使用するダイシング治具2の材料としては剛性の高い材料(金属、セラミックス等)を用いるものとするが、加工が容易なセラミックス材料マコールが適している。

【0023】また、治具2の他の材料としてはシリコンウェハを用いてもよい。

【0024】なお、ダイシング治具2としてシリコンウ 30 ェハを用いる場合、方位而 (110)や、 (100)と (110)とを酸化膜や多結晶シリコンなどを介して接 合したウェハなどでもよい。

【0025】そして、治具2に形成する絶縁膜穴や凹部の加工方法としてはKOHなどのアルカリ性異方性エッチングやレーザー加工などがある。

【0026】また、エアー吹出し口2eとしての溝内に 挿入されるOリング2cによりダイシング治具2の周縁 部が中央部より高くなって、ウェハ1の反りが発生した ときに備えて、ウェハ1の反りを抑える方向に治具2の 40 中央部に必要とする高さの突起部(図示せず)を設ける ようにしてもよい。

【0027】なお、以下の説明ではウェハ1の各チップ に形成される機能素子が有する可動部や突起物を総称し てセンサ1aとして説明するものとする。

【0028】次に、第1の実施例によるダイシングカットの工程フローについて図2を参照して説明する。

【0029】(1) 先ず、図2(a) に示すようにダイ

【0030】 (2) 続いて、図2 (b) に示すように可 動部または突起物 (センサ1a) を有する半導体装置が

動部または突起物 (センサ1 a) を有する半導体装置が 形成されたウェハ1をアライメント後、ダイシング治具 2上に載せる。

【0031】この際、ダイシング治具2の凹部2aはセンサ1aを十分に保護することができる形状となっているものとする。

【0032】また、素子パターンと治具凹部との位置合わせの方法としては、光学プローブにより両方のパターンを同時に観察し、画像認識装置で位置合わせを行うようにしたり、予め、素子が形成されたウェハに対し、ダイシングラインでカット成形しておき、治具側にも段差を設けてそこに合わせる等の方法をとることができる。

【0033】ただし、ダイシングラインでカットしておく方法は、センサ1aがその製造プロセスの過程で固定されている必要がある。

【0034】(3)次に、図2(c)に示すようにダイシングカット装置の真空チャックステージ(図示せず)のパキューム吸引によりダイシング治具2およびウェハ1を固定する。

【0035】なお、ダイシング治具2のウェハ固定用真空チャック穴としての貫通孔2bの位置および個数は、ウェハ1がダイシングカット時にずれることなく固定されればよく、その条件を満たせばどこに形成してもよい。

【0036】また、ダイシング治具2の外周縁部に設けた〇リング2cおよびエアー吹出し口2cはダイシングカット時に用いられる研削水の侵入を防止するためのものであるが、研削水が侵入しなければ、〇リング2cまたはエアー吹き出し(吹き出しは他のガスでもよい)のいずれかであってもよいが、望ましくは両方備えるのが好ましい。

【0037】そして、ウェハ1およびダイシング治具2の固定後にダイシングカット1bを行うが、このダイシングカット1bの切り込み深さは極力深くして(ウェハ1の半分以上の切り込み深さが望ましい)、後のチップ分割を容易にする。

【0038】(4)次に、図2(d)に示すようにダイシングカット装置のパキューム吸収を停止し、切り込みを入れて強度的に弱くなっているウェハ1をダイシングカット装置から外すためにダイシングカット用粘着シート3で貼り付ける。

【0039】(5)図2(e)に示すようにダイシング 治具2からウェハ1を外した後、図2(f)に示すよう にチップ分割する。

【0040】このチップ分割の方法としては例えば、エキスパンディングによる方法やヒートショックを与えたり、もしくは、図2(d)に示したような状態でローラ

る。

【0041】 (第2の実施例) 図2に示した第1の実施 例では、ダイシングカット時フルカットしないために、 ダイシングカット後にチップ分割を行う工程が必要とな

【0042】次に、フルカットによりこのチップ分割工 程を削除する例について述べる。

【0043】この場合に使用するダイシング治具2Aは 図3、4に示すように、図1からOリング2c、エアー 導入孔2d及びエアー吹出し口2eを削除し、貫通孔2 10 dを凹部2aの直下に形成してある。

【0011】ダイシング治具2Aの材料は微細機械加工 が容易にできるセラミックス製マコールでも、KOHな どのアルカリ性異方性エッチングにより加工できる面方 位(110)や(100)と(110)とを絶縁物など で接合したシリコンウェハでもよい。

【0015】次に、第2の実施例によるダイシングカッ トの工程フローについて図5を参照して説明する。

【0046】(1) 先ず、図5(a) に示すように、こ の 実施例では 凹部 2 a の一部に 貫通孔 2 b を設けている 20 ダイシング治具2Aが用いられる。

【0047】なお、凹部は治具の構造上貫通孔の径が小 さい場合必要となるが、貫通孔のみでもよい。

【0018】(2)次に、図5(b)に示すようにダイ シング治具2Aの表面に熱硬化性粘着シート4を粘着面 を上側にしてセットした状態で図示しない真空チャック 上に治具2Aを置き、ダイシング治具2Aの貫通孔2b を通して熱硬化性粘着シート4をパキュームにより凹部 2 a に沿って吸い付ける。

うに、ウェハ1を熱硬化性粘着シート4の粘着面に密着 させる。

【0050】この場合、例えばウェハパターンと治具パ ターンを画像認識により合わせてからウェハ1とダイシ ング治具2Aとを粘着シートを介して密着させる。

【0051】(4)次に、図5(e)に示すように、ウ エハ1の裏面側より、図示しないダイシングカット装置 の刃が熱硬化性粘着シート4に達するまでウェハ1に対 してチップ毎にフルカット1cを行う。

の粘着力を低下させ、再度ウェハ裏面に紫外線硬化性粘 **着シート(図示せず)を貼って、通常のエキスパンディ** ングにより図5 (f) に示すようにチップ毎の間隔を広 げる。

【0053】この場合、ウェハ裏面に紫外線硬化性粘着 シートを貼り付けてから、加熱により熱硬化性粘着シー ト4の粘着力を低下させるようにしてもよい。

【0054】(第3の実施例)これまでの実施例ではダ イシング治具を使用してのダイシングカットを行う方法 であったが、図6に示す第3の失施例では治具を使用せ 50 ずにダイシングカットする方法である。

【0055】次に、この第3の実施例によるダイシング カットの工程フローについて図6を参照して説明する。

【0056】(1) 先ず、図6(a) に示すように、可 動部を有する半導体センサなどの半導体装置が形成され たウェハ1のセンサ1aの周辺にそれを取り巻く壁1d を形成するために接着剤などを例えばスクリーン印刷法 により印刷する。

【0057】この際、後の工程で貼り付ける粘着シート 5がダイシングカット時にセンサ1aに触れないように フィラーなど入れるなどしてできるだけ接着剤の高さを 高くし、また、センサ1aと接着剤との距離をできるだ け近づける。

【0058】その後、オープンなどを用いて加熱するこ とにより接着剤を硬化させて壁1 dを形成する。

【0059】(2)次に、図6(b)に示すようにウェ ハ1をウェハマウンタ真空チャック6に乗せて固定す る。

【0060】(3)次に図6(c)に示すようにウェハ 1の表面側において接着剤の印刷により形成された壁 1 d上に粘着シート5を貼り付ける。

【0061】(4)続いて、図6(d)に示すようにダ イシングカット装置ステージの真空チャック7上に、粘 **着シート5を貼り付けたウェハ1を接着剤が印刷されて** 壁1dが形成された面を真空チャック7側に乗せて固定 する。

【0062】(5)次に、図6(e)に示すようにウェ ハ1の裏面よりダイシングカット1bを行う。

【0063】このときのウェハの切り込み深さはできる 【0019】(3)次に、図5(c),(d)に示すよ 30 だけ深くする(切り込み深さはウェハの厚みの半分以上

> 【0064】(6)次に、図6(f)に示すように、ウ エハ1を真空チャック7から外し、その後のチップ分割 は第1の実施例で述べた方法と同様に行う。

> 【0065】なお、第1の実施例において、ウェハ載置 兼封止用のパッキングとなるOリング1cの代わりに変 形しやすいシリコンゴムを用いるようにしてもよい。

【0066】また、第2の実施例において、ウェハ裏面 に貼り付ける紫外線硬化性粘着シートの代わりに、熱硬 【0052】その後、加熱により熱硬化性粘着シート4 40 化性粘着シート4よりも耐熱性の高い熱硬化性粘着シー トを用いるようにしてもよい。

> 【0067】また、第2の実施例において、熱硬化性粘 着シート4とダイシング治具2Aとの接合はダイシング 治具2Aの貫通孔2bからのパキューム吸引によるが、 この際、パキュームの吸引力に応じ、貫通孔 2 b の径の 大きさ、位置、数を決めるものとすると共に、熱硬化性 粘着シート4が凹部2aに沿って撓むようになれば、貫 通孔2bは必ずしも凹部2a内に設けなくてもよい。

[0068]

【発明の効果】従って、以上詳述したように本発明によ

10

れば、半導体装置内の機能素子が有するトランジスタ型加速度センサの可動ゲートや圧力センサのダイアフラムのような可動部またはエアーブリッジ配線構造のような突起物を、ダイシングカット時にレジストなどの液体を使用することなく保護してダイシングカットすることにより、高歩留りでチップ分割をすることができるようにした半導体装置の製造方法及びそれに用いるダイシング治具を提供することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施例に用いるダイシング治具と半導体 ウェハとの対応関係をそれぞれ半分に切欠いて示す図。

【凶2】第1の実施例によるダイシングの工程フローを示す図。

【図3】第2の実施例に用いるダイシング治具と半導体

ウェハとの対応関係をそれぞれ半分に切欠いて示す図。

【図4】第2の実施例に用いるダイシング治具の断面 図。

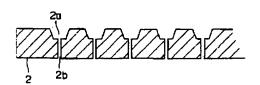
【図5】第2の実施例によるダイシングの12型フローを 示す図。

【図6】第3の実施例によるダイシングの工程フローを示す図。

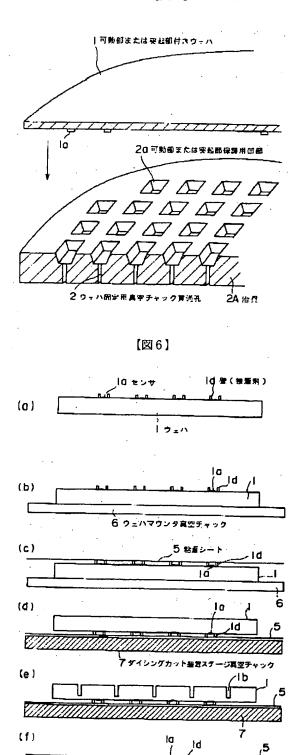
【符号の説明】

1…可動部または突起部付き半導体ウェハ、1a…セン 10 サ (可動部または突起部)、2…ダイシング治具、2a …可動部または突起部保護用凹部、2b…ウェハ固定用 真空チャック貫通孔、2c…〇リング、2d…エアー導 入孔、2e…エアー吹出し口(〇リング挿入用溝)、3 …粘着シート。

【図4】



【図3】



[図5]

